



Caractérisations résolues en temps du transport des atomes pulvérisés neutres et ionisés en procédé HiPIMS : fluorescence induite par diode laser et spectrométrie de masse

Ecole technologique des plasmas froids

15<sup>e</sup> journées du réseau

Ludovic de Poucques

01/10/2020

### Plan

#### Introduction

Pulvérisation cathodique magnétron, HiPIMS, transport des atomes neutres, objectifs.

#### Dispositif expérimental : TR-TDLIF (Time Resolved-Tunable Diode Laser Induced Fluorescence)

Montage optique, résolution temporelle

#### Déterminations des fonctions de distribution des atomes neutres W et Ti par TR-TDLIF

#### Détermination de la fonction de distribution des ions Ti<sup>+</sup> par spectrométrie de masse

Résolution temporelle





#### **Pulvérisation cathodique**

- Décharge DC de type diode :



- Limite : pression (qq 10 Pa < P < ~1000 Pa)

- Baisser la pression

→ grand lpm des e<sup>-</sup>, tension d'amorçage élevée, U<sub>décharge</sub> élévée, instabilitées





#### Pulvérisation cathodique magnétron

Pulvérisation cathodique magnétron conventionnelle (dc-MS or rf-MS) :

- Développée depuis les années 70 pour des applications en microélectronique

- Très largement utilisée pour le dépôt de couches minces (métaux, oxydes, nitrures, céramiques, etc)



#### Pulvérisation cathodique magnétron

Pulvérisation cathodique magnétron conventionnelle (dc-MS or rf-MS) :

- dc-MS or rf-MS : degré d'ionisation des atomes pulvérisés est très faible (~<1%).

Atomes pulvérisés restent essentiellement neutres (entre la cible et le substrat) (ions contribuent peu au dépôt)

Dans le but de développer des nouvelles applications (e. g. dépôts conformes sur des substrats complexes : 3D), il est nécessaire de ioniser les atomes neutres pulvérisés (contrôler leurs trajectoires et énergies)

HiPIMS : High Power Impulse Magnetron Sputtering (Développé à la fin des années 90)





#### Procédé HiPIMS : étudié depuis le début des années 2000

HiPIMS: high power impulse magnetron sputtering

But : ioniser directement la vapeur par un plasma magnétron très dense afin de réduire considérablement la longueur d'ionisation des atomes pulvérisés.







#### Procédé HiPIMS : étudié depuis le début des années 2000

HiPIMS: high power impulse magnetron sputtering

But : ioniser directement la vapeur par un plasma magnétron très dense afin de réduire considérablement la longueur d'ionisation des atomes pulvérisés.







#### Procédé HiPIMS : étudié depuis le début des années 2000

HiPIMS: high power impulse magnetron sputtering

But : ioniser directement la vapeur par un plasma magnétron très dense afin de réduire considérablement la longueur d'ionisation des atomes pulvérisés.



Polarisation pour contrôler les ions.

Difficile de contrôler les neutres et une fraction importante subsiste (caractérisation du transport).





#### Transport des atomes neutres pulvérisés



#### Transport des atomes neutres pulvérisés



La connaissance des propriétés des atomes neutres pulvérisés participant aux dépôts est importante pour une meilleure compréhension des processus (interaction plasma-surface en procédé magnétron....)

caractériser finement le transport par diagnostics Laser







#### Mettre au point des diagnostics résolus en temps (et l'espace) pour caractériser le transport des espèces neutres

#### Procédé HiPIMS

- Dimension temporelle : cinétique de transport.
- Bien connaître les distributions des espèces (Δt pour bien séparer les populations).
- Prise en compte dans les modèles (données d'entrée, benchmark, affiner les sections efficaces à relativement basse énergie (<10 eV)).







INSTITUT

Literature : some TR laser measurements on neutral sputtered atoms in HiPIMS









Literature : some TR laser measurements on neutral sputtered atoms in HiPIMS







#### Montage optique





#### Montage optique



1<sup>er</sup> faisceau (20 %=4 mW) : interféromètre Fabry–Pérot ( $\Delta v$ =c/2nL=1 GHz : intervalle spectral libre) pour calibrer la variation temporelle de la longueur d'onde laser ( $\Delta \lambda_{laser}(t)$ ).







#### Montage optique



2<sup>ème</sup> faisceau (80 %=16 mW) :

- Réacteur

- Perpendiculairement à la surface de la cible pour mesurer **v**<sub>z</sub>

- Centre de la piste de pulvérisation  $(R_0=1,3 \text{ cm})$ 





#### Montage optique







#### Montage optique



Système de détection + section faisceau DL

#### Volume sondé ≈ 3 mm<sup>3</sup>

Résolution spatiale : VDF(z)

Système de détection fixé

Cathode magnétron déplacée grâce à un système soufflet+déplacement linéaire







Ludovic de Poucques – 01/10/2020

#### **Résolution temporelle**



#### **Résolution temporelle**



#### Analyse des mesures TR-TDLIF

T<sub>on</sub>/T<sub>off</sub> : 7.5 μs/1.5 ms

- Court  $T_d$  (7.5 µs) : séparer les processus de production des atomes et le début du transport





#### **Analyse des mesures TR-TDLIF**







#### **Analyse des mesures TR-TDLIF**

i	%	Δλ(pm)
<sup>182</sup> W	26,50	- 0.16 pm
<sup>183</sup> W	14,31	0 pm
$^{184}W$	30,64	0.14 pm
<sup>186</sup> W	28,43	0.40 pm

#### <u>4 isotopes</u>

Analyse automatique : 2 groupes de 4 Gaussiennes







#### **Analyse des mesures TR-TDLIF**











#### Effet de l'He sur le transport



#### Effet de l'He sur le transport



#### Effet de l'He sur le transport







#### Effet de l'He sur le transport











#### Analyse des mesures TR-TDLIF



AVDF des atomes QTH est anisotrope ( $\langle v_z \rangle_{QTH} > 0$ ) avec  $\langle E_z \rangle_{QTH}$  qui décroît jusqu'à ~0.05 eV (=  $\langle E_z \rangle_{TH}$ ;  $\langle v_z \rangle_{TH} = 0$ ).





#### Analyse des mesures TR-TDLIF



#### **Exploitation** des mesures TR-TDLIF



A basse pression, le flux déposé est dominé par les atomes EN

A plus haute pression, le flux dominant dépend de la distance par rapport à la cible

Quel est le pourcentage de  $\Phi_{\rm EN}$  qui s'est thermalisé avant le volume sondé ?





#### **Exploitation** des mesures TR-TDLIF







#### **Exploitation des mesures TR-TDLIF**



A basse pression, le flux déposé est dominé par les atomes EN

A plus haute pression, le flux dominant dépend de la distance par rapport à la cible

Quel est le pourcentage de  $\Phi_{\rm EN}$  qui s'est thermalisé avant le volume sondé ?





#### **Exploitation des mesures TR-TDLIF**



Figure 5: Scheme of the sputtered emission cone.

```
EN : S(z)=\pi[R<sub>0</sub>+tan(\alpha)×z]<sup>2</sup>
(TH : S(z)=4\pi[z-z<sub>th</sub>]<sup>2</sup>)
(n(z)=n(0)/\pi[R<sub>0</sub>+tan(\alpha)×z]<sup>2</sup>
```



~70 % des atomes EN sont émis dans un cône d'angle  $\alpha$ =45° en considérant une distribution angulaire en cosinus





#### Caractéristiques du spectromètre Hiden (EQP-300)

- > Analyseur en énergie (0 à 100 eV pour les ions chargés une fois)
- Analyseur en masse quadripolaire
- Détecteur SEM (secondary electron multiplier)







Mesures résolues en temps (porte d'intégration du détecteur SEM synchronisée avec la décharge HiPIMS).





Porte d'intégration de 20 µs (générateur de fonctions dont les deux voies sont synchronisées entre elles : l'une pour commander le générateur HiPIMS et l'autre le détecteur).







Figure 4.2 Mesure typique des TR-IEDFs des ions Ti<sup>+</sup> en procédé HiPIMS (en argon pur,  $P_{Hi}$ . PIMS = 350 W/cm<sup>2</sup>, p = 5 mTorr et à z = 5 cm).











### Ions Ti<sup>+</sup> par spectrométrie de masse (MS) <u>4 populations d'ions</u>



- ➢ Pop1 : 0-2 eV
- ➢ Pop2 : 2-15 eV
- ➢ Pop3 : 15-45 eV
- ➢ Pop4 : 45-100eV





#### Effet de la pression et la distance z









#### Effet de la pression et la distance z







Effet de la pression sur les 4 populations d'ions

Ti+\_70 W\_5 cm\_5 mTorr\_0%N<sub>2</sub>

Ti+\_70 W\_5 cm\_20 mTorr\_0%N<sub>2</sub>



Mesures résolues en temps par rapport au début de la décharge HiPIMS : soustraire le temps de transfert des ions dans le SM (~feuille Excel).





### **Merci pour votre attention**



